

硅片清洗剂配方有效成分检测，技术转让

产品名称	硅片清洗剂配方有效成分检测，技术转让
公司名称	杭州柘大检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:柘大检测 型号:成分
公司地址	杭州市西湖区西溪路525号B楼209室
联系电话	0571-87759051 15397161905

产品详情

硅片清洗剂配方有效成分检测，技术转让

硅片清洗剂广泛应用于光伏，电子等行业[硅片清洗](#)；由于硅片在运输过程中会有所污染，表面洁净度不是很高，对即将进行的腐蚀与[刻蚀](#)产生很大的影响，所以首先要对硅片表面进行一系列的清洗操作。清洗的一般思路首先是去除表面的有机沾污，然后溶解氧化膜，因为氧化层是“沾污陷进”，会引起外延缺陷；再去除颗粒、金属等，同时使硅片的表面[钝化](#)。

目前多采用传统的RCA清洗方法，不仅可以去除硅片表面的金属、有机物等，还可以去除小颗粒等污染物。

SPM具有很高的金属氧化能力，可将金属氧化后溶于清洗液中，并能将有机物氧化生成二氧化碳和水。用SPM清洗硅片可以去除表面的种有机沾污和部分金属，当沾污特别严重时，难以去除干净。

DHF（HF），可以去除硅片表面的自然氧化膜，同时抑制氧化膜的形成。易去除硅表面的Al、Fe、Zn、Ni等金属，也可以去除自然[氧化膜](#)上的[氢氧化物](#)。在自然那氧化膜被腐蚀掉时，硅片几乎不被腐蚀。

热态洗硅成膜剂

，包括A剂和B剂，A剂包含强碱性催化剂5%~35%、无机溶剂65%~95%，[显色剂](#)

微量，原料总和为100%；B剂包含分析纯[磷酸三钠](#)0.3%~3%、分析纯[联氨](#)0.05%~2%，与两种无机溶剂，其原料总和为100%；使用时由A剂和B剂按照体积比1:10的比例混合使用，混合后溶液比重为1.008g/ml~1.031g/ml。

日本索尼公司研制的HF/O₃单片旋转式清洗法，可以有效去除硅表面的有机沾污、无机沾污、金属沾污等。此设备上有三路供液系统，可同时将HF酸、溶解油臭氧的[超纯水](#)、超纯水供应到硅片中心。在此过程中，首先将HF酸、溶解油臭氧的超纯水交替供应到硅片中心，每种试剂供应约10s交替一次，接着供应纯水进行冲洗。最后用旋转干燥法对硅片进行干燥，为避免旋转干燥法给硅片表面带来水迹，可以改用[氮气](#)吹。

有效成分是化学，生物学，药理学广泛应用的术语，指一种混合物中，对生物体代谢或者化学反应起作用的成分。

24小时服务电话：0571-87759051 15397161905 余工